

4

経営資本

- 31 最先端のフラッシュメモリ工場
- 35 テクノロジー
- 39 パートナースhip
- 41 人材

1 キオクシアとは

2 トップメッセージ

3 価値創造の取り組み

4 経営資本

5 ガバナンス

6 データセクション

最先端のフラッシュメモリ工場 製造資本



キオクシアグループの強み

当社グループは、四日市工場（三重県四日市市）と北上工場（岩手県北上市）を合わせた世界最大級のフラッシュメモリ生産規模によるスケールメリットと、AIとビッグデータを活用したスマートファクトリーで実現する高い生産効率を強みとしています。高いコスト競争力で拡大するフラッシュメモリ需要に対応し、当社グループの持続的な成長を支えています。

生産規模・生産効率に基づくコスト競争力



1 キオクシアとは

2 トップメッセージ

3 価値創造の取り組み

4 経営資本

＞最先端のフラッシュメモリ工場

テクノロジー

パートナーシップ

人材

5 ガバナンス

6 データセクション

世界最大級のフラッシュメモリ生産規模

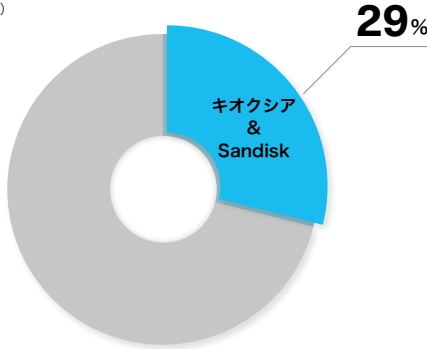
四日市工場・北上工場を合わせたフラッシュメモリの生産量（記憶容量ベース）は、キオクシアグループと、米国Sandiskグループとの製造合併会社分を合わせて、世界最大級となる29%※に上ります。

両工場では、生産能力の約80%は製造合併会社分として米国Sandiskグループと等分で共有しており、残りの約20%は当社グループが単独で保有しています。そのため、両工場で生産されるフラッシュメモリの約60%が当社グループに割り当てられます。また、当社グループは両工場の管理・運営を行っており、高度な製造ノウハウを有しています。

四日市工場では2022年10月から第7製造棟が稼働し、北上工場では2025年9月に第2製造棟が稼働を開始しています。今後も拡大すると想定されるフラッシュメモリの需要に継続的に対応します。

※出典：TechInsights Inc. 「NAND Market Report Q2 2025」

フラッシュメモリ生産量世界シェア
（記憶容量ベース、2024年度）



出典：TechInsights Inc. 「NAND Market Report Q2 2025」

四日市工場

(三重県四日市市)

四日市工場は1992年の設立以来、最先端のメモリ製品製造拠点として発展してきました。694,000m²の広大な敷地に6つの前工程の製造棟と1つの後工程（組立工程）の製造棟があります。2022年10月から第7製造棟が稼働しています。

6つの製造棟を統合する生産体制や、AIとビッグデータの活用により、生産効率を高めています。また、併設する研究・技術開発部門との緊密な連携で、新製品の開発から量産へのスムーズな移行を実現しています。



四日市工場

北上工場

(岩手県北上市)

北上工場はフラッシュメモリの需要拡大に対応するための量産拠点として、第1製造棟が2020年に、第2製造棟が2025年9月に稼働開始しました。今後も、需要の拡大に合わせて生産規模を拡大する予定です。量産に特化しており、歩留まりや生産性を高めています。四日市工場とデジタル技術を活用して連携し、そのノウハウを継承して高品質な製品を高い効率で生産することに貢献します。



北上工場

- 1 キオクシアとは
- 2 トップメッセージ
- 3 価値創造の取り組み
- 4 経営資本

＞最先端のフラッシュメモリ工場

テクノロジー

パートナーシップ

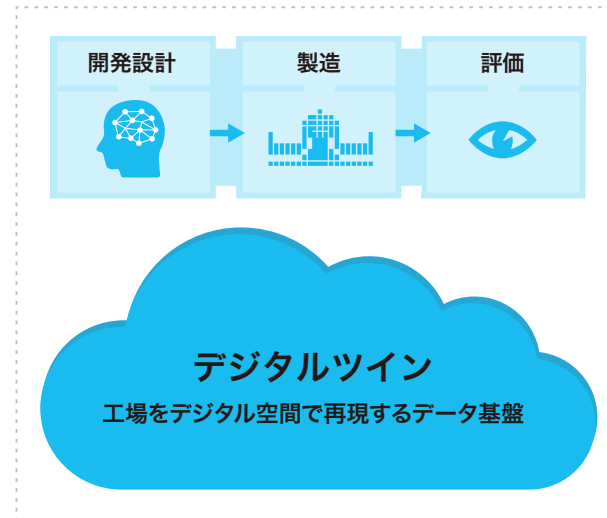
人材
- 5 ガバナンス
- 6 データセクション

スマートファクトリー

仮想空間に工場を再現する「デジタルツイン」

四日市工場と北上工場は、「デジタルツイン」を活用して高度に連携しています。両工場の製造装置やシステムから取得したデータを仮想空間にリアルタイムに再現し、膨大なデータをもとに最適化された条件を両工場の製造プロセスに適用するものです。これにより、両工場でのノウハウの共有が効果的に進み、高い生産性を実現しています。

デジタル工場



リアル工場



AIとビッグデータを駆使した品質管理

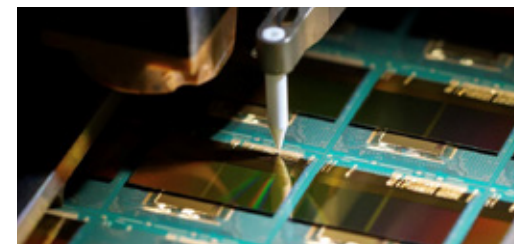
工場では製造装置や検査・計測装置から日々膨大な製造関連データが発生し、四日市工場ではその件数は約30億件にも上ります。これらのデータをリアルタイムでAIを活用して分析し、製品不具合の防止や、不良が発生した際の原因の自動推定などに活用しています。例えば、デバイスの品質検査において従来は技術者がウエハーの検査データを1枚ずつ見比べて不良の特徴を見極めて分類していたものを、AIを用いた高速な自動解析を実現することで99%の時間削減に成功しました。



天井走行式無人搬送車 (OHT: Overhead Hoist Transport)

組立工程の強化

当社グループは、半導体・SSDの組立工程の大半を海外の専門メーカーに製造委託することで生産効率を高めており、また、サプライチェーンの強化にも取り組んでいます。一方で、組立技術の高度化に対応するために、組立技術を開発し、四日市工場においても先端製品を中心に組み立てを行っています。



1 キオクシアとは

2 トップメッセージ

3 価値創造の取り組み

4 経営資本

▶ 最先端のフラッシュメモリ工場

テクノロジー

パートナーシップ

人材

5 ガバナンス

6 データセクション

最先端のフラッシュメモリ工場 製造資本

事業継続のための備え

メモリ製品を社会に提供する事業を行うキオクシアグループにとって、製造拠点は事業継続の要です。当社グループは四日市工場、北上工場の国内2拠点を構え、BCM（Business Continuity Management：事業継続マネジメント）体制のもとに工場の防災対策や有事の際の対応、早期復旧の体制づくりを推進しています。

例えば、地震対策としては、建物の揺れを吸収する免震構造を採用しています[※]。また、停電や瞬間的な電力低下（瞬低）からの重要設備保護のための装置を設置しています。

さらに、自然災害や地政学リスクなどを考慮し、調達取引先の複線化や部品の共通化・点数削減などによる強靱なサプライチェーンの構築に取り組んでいます。

※四日市工場においては2007年9月に竣工した第4製造棟以降、北上工場においては第1・第2製造棟共に採用。



工場の免震装置

持続可能な生産活動

環境配慮の取り組み

キオクシアグループの製造拠点では、持続可能性を考慮して、廃棄物削減・化学物質管理・排水の水質管理など、環境負荷に配慮した事業活動を推進しています。

当社グループでは、水資源有効利用のため、製造工場における取水量と排水量を抑制する取り組みを展開しており、製造プロセスで使用した水の一部を工場内で回収・再生し、再度利用しています。

気候変動への対応

当社グループの製造拠点では、温室効果ガス排出量の削減や再生可能エネルギーの活用を推進し、脱炭素社会の実現に貢献します。

ネットゼロ（2050年度までに）

当社グループは、2050年度までに事業活動に伴う温室効果ガス排出量（事業場からの直接排出（Scope1）、および購入エネルギー使用に起因する排出（Scope2））をネットゼロ（温室効果ガスの排出量と吸収・除去量を差し引きゼロ化）にするという目標を設定しています。また、当社は気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の提言に賛同を表明しています。

再生可能エネルギー利用率

100%

（2040年度までの目標）

目標達成に向け、工場内でのソーラーパネルの設置など、再生可能エネルギーの活用を拡大していきます。

PFC等ガス[※]除害装置設置率

100%

（2011年以降稼働の製造棟）

当社グループのウエハー製造工程では、温暖化係数が高いPFC等ガスを分解して排出する除害装置を2011年以降は対象設備（新規稼働）に100%設置しています。

※半導体製造時に使用する地球温暖化係数の高い代替フロンガス。当社グループの使用物質ではCF₄、C₆F₈、CHF₃、SF₆、NF₃、CH₂F₂、CH₃F、CH₄、N₂Oが対象。



四日市工場第5製造棟の太陽光発電システム



北上工場第1製造棟の太陽光発電システム

1 キオクシアとは

2 トップメッセージ

3 価値創造の取り組み

4 経営資本

▶ 最先端のフラッシュメモリ工場

テクノロジー

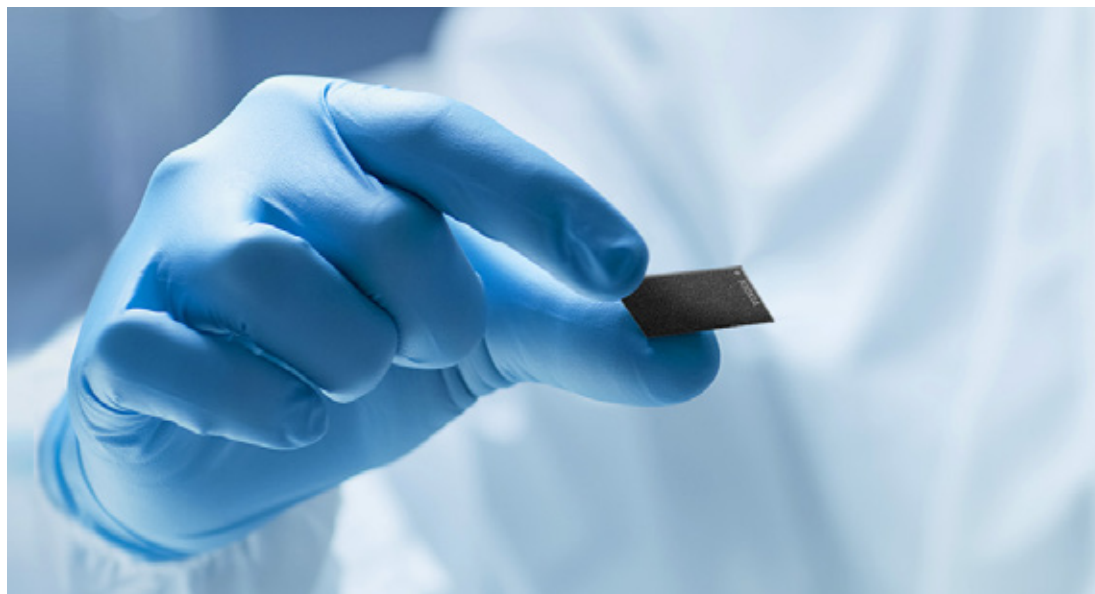
パートナーシップ

人材

5 ガバナンス

6 データセクション

テクノロジー 知的資本



特 徴

研究開発費
1,328億円
(2024年度)

登録特許数
14,000件超
(2024年12月時点、キオクシア(株))

NAND型フラッシュメモリの発明をはじめとした
数多くの「世界初」を創出

「記憶」のテクノロジーリーダーとして
高度で多様な研究・技術開発を推進

研究・技術開発の強みと方針

キオクシアグループは、NAND型フラッシュメモリの発明をはじめとする多くの「世界初」を積み重ね、社会にイノベーションを生み出すことに貢献してきました。

今後さらに高度化、多様化するニーズに応えるために、中長期的な成長を見据えた研究・技術開発への投資、体制整備を進めています。また、技術者の積極的な採用および育成・スキル強化（▶P.42）や、研究開発パートナーとの連携（▶P.39）で技術力を継続的に向上し、テクノロジーリーダーシップを堅持します。

既存領域、新規領域で市場ニーズに応え、ビジネスチャンスを拡大しテクノロジーリーダーシップを堅持します

「記憶」のテクノロジーをリードする先端技術の創出

持続的な研究開発投資

将来を見据えて、
成長分野に注力した
研究開発投資を継続します。

AIやDXなどデジタル技術の発展による
ニーズの高度化、多様化

ハイレベルな技術者の採用・育成

最先端技術開発を担う
専門性の高い人材を獲得し、
ハイレベルな人材が活躍できる
仕組みをつくります。

市場拡大に伴う技術者の
人材獲得・スキル強化の必要性

パートナーとの連携

さまざまな分野の
研究開発パートナーと
シナジーを生み出し、
共に社会に価値を創造していきます。

半導体メモリ分野における
技術開発の難化・競争の激化

環境認識

1 キオクシアとは

2 トップメッセージ

3 価値創造の取り組み

4 経営資本

最先端のフラッシュメモリ工場

▶テクノロジー

パートナーシップ

人材

5 ガバナンス

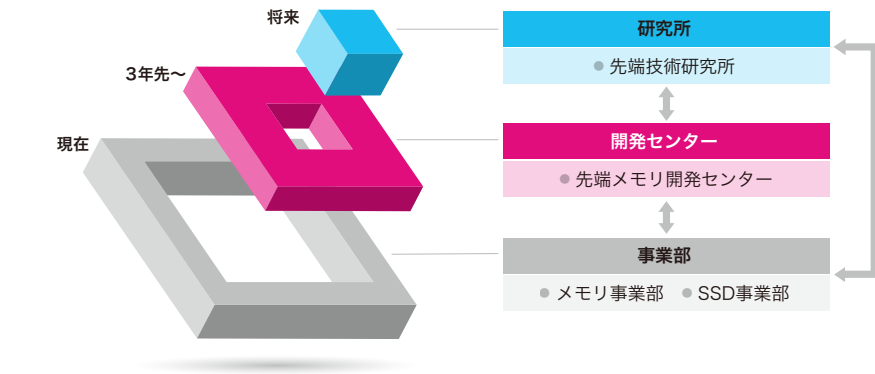
6 データセクション

研究・技術開発体制と拠点

キオクシアグループは「記憶」の技術で業界をリードする研究・技術開発体制を構築しています。さらに顧客やパートナーとの連携、産学連携でオープンイノベーションを推進し、技術革新に取り組んでいます。

当社グループは、長期的視点で将来技術を研究する研究所、製品への適用技術を開発する開発センター、製品を開発する事業部が連携した研究・技術開発体制で、「研究」を「製品」に結実します。

キオクシアグループの研究・技術開発体制



■ 先端技術研究所	AI技術とその応用を支える技術、新原理や新材料を駆使した大容量・高速メモリシステム技術、そして半導体メモリを低コストで製造するための新規プロセス技術などの研究開発を推進していきます。
■ 先端メモリ開発センター	3次元フラッシュメモリ「BiCS FLASH™」の研究開発と量産化の橋渡しを行っています。
■ メモリ事業部・SSD事業部	高度化、多様化するニーズに対応するメモリ・SSD製品の企画、開発、マーケティングを担います。

キオクシア（株）の研究・技術開発は、横浜テクノロジーキャンパス（横浜市栄区）や四日市工場にあるメモリ開発センター（三重県四日市市）などで行っています。横浜テクノロジーキャンパスはメモリ・SSDの研究開発から企画、設計、開発、評価を担います。新子安テクノロジーフ

ロント（横浜市神奈川区）は先端研究用のクリーンルームを備え、新材料や新プロセス、デバイスを中心とした幅広い研究に取り組んでいます。メモリ開発センターは四日市工場のクリーンルームを利用した研究開発も行っています。

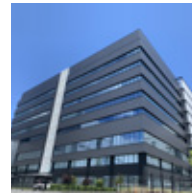
また、海外の研究・技術開発の拠点は、先端技術へ迅速にアクセスし、市場・お客様ニーズへ柔軟に対応するため、先進的なIT企業が数多く所在する国・地域にあります。



横浜テクノロジーキャンパス
Flagship棟



新子安テクノロジーフロント



メモリ開発センター

知的財産の取り組み

当社グループは、自社の知的財産を適切に保護し、活用するとともに、第三者の正当な知的財産権を尊重しています。キオクシア（株）は、2024年12月時点で、全世界で14,000件を超える登録特許を保有しています。

TOPICS

第14回「Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター2025」を受賞

キオクシア（株）は、英国クラリベイト社が保有する特許データをもとに同社が独自に知財・特許動向を分析し、世界で最も革新的な企業・機関を選出し表彰する「Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター 2025」を受賞しました。当社は今回で4年連続の受賞となります。

当社グループは、知的財産の保護と有効活用により、事業の競争力強化に向けた取り組みを積極的に展開していきます。

1 キオクシアとは

2 トップメッセージ

3 価値創造の取り組み

4 経営資本

最先端のフラッシュメモリ工場

▶テクノロジー

パートナーシップ

人材

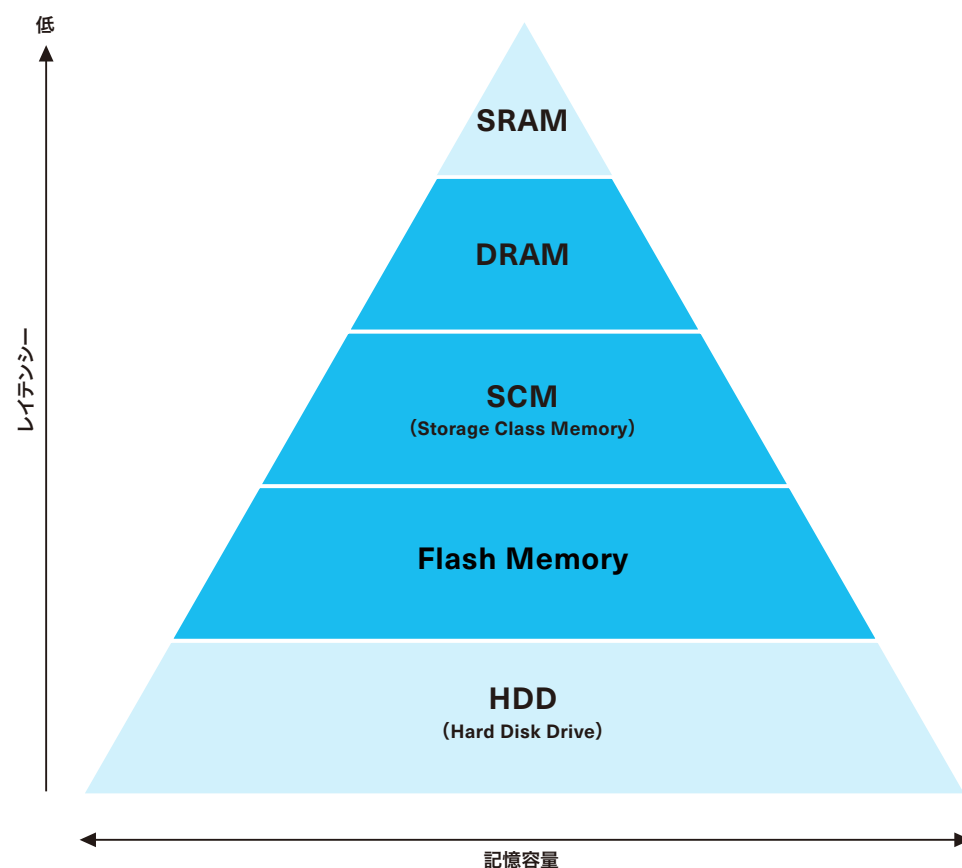
5 ガバナンス

6 データセクション

最近の研究・技術開発成果

キオクシアグループは、生成AIの発展をはじめ急速に変化するデジタル社会に不可欠となる半導体メモリの研究・技術開発に注力しています。3次元フラッシュメモリ技術「BiCS FLASH™」に加え、新しいコンセプトの半導体メモリなど多種多様な分野における研究・技術開発を進め、将来のコンピューター、ストレージシステムにおける半導体メモリの大容量化、高性能化、高付

加価値化へのニーズに応えることを目指しています。その研究成果を半導体分野の主要な国際会議であるIEDM (International Electron Devices Meeting) 2024やISSCC (International Solid-State Circuits Conference) 2025などにおいて発表しました。



酸化物半導体を用いたDRAM技術 (OCTRAM)

- 従来とは異なる材料・構造である縦型の酸化物半導体 (InGaZnO) トランジスタを採用
- 大規模メインメモリが搭載されるサーバーやIoT製品などの低消費電力化を実現する可能性
- 4F2レイアウト※を採用しメモリセルアレイ密度の向上が可能

※設計ルールに対するメモリセルの大きさを表し、現在のDRAMの主流の設計である6F2レイアウトと比較して、理論上、メモリセルアレイの密度が1.5倍向上します。

大容量クロスポイント型MRAM技術

- DRAMよりも大容量、NANDよりも高速の性能を持つSCM (ストレージクラスメモリ) の一つ
- MRAMとして過去最小のセルサイズにおいて、セルの読み出し、書き込み動作を実現

水平セル積層構造の3次元フラッシュメモリ技術

- NAND型セルを従来の垂直方向ではなく水平方向に配置し積層した新しい構造
- さらなるフラッシュメモリの大容量化を実現する技術

1 キオクシアとは

2 トップメッセージ

3 価値創造の取り組み

4 経営資本

最先端のフラッシュメモリ工場

テクノロジー

パートナーシップ

人材

5 ガバナンス

6 データセクション

技術統括責任者メッセージ

メモリの技術を軸に、時流を捉えた研究・技術開発で
テクノロジーリーダーシップを堅持します

キオクシアグループは1987年のNAND型フラッシュメモリの発明以来、大容量、高性能など高度化する市場ニーズに応えてきました。2007年に世界に先駆けて発表した3次元構造のフラッシュメモリ「BiCS FLASH™」は、スマートフォンやデータセンターなどに搭載され、その用途を広げています。

近年は生成AIの発展で、ストレージへの要求はさらに高度化、多様化しています。3次元フラッシュメモリはメモリセルの積層数を増やすことで大容量化を狙いますが、一方で、高積層化により製造コストは大幅に増え、製造工期は長くなります。当社グループは積層数を増やす方法以外にも、平面方向にメモリセルを縮小する技術やCBA技術（▶P.21）などを導入することで、大容量化とコストの両立を図っています。また、積層数が1,000層を超えるとさらにコストが高くなるため、メモリセルを水平方向に配置する新しい構造（▶P.37）などの研究・技術開発も進めています。この技術は2030年代初めの導入を目指します。

当社グループは、将来のコンピューター、ストレージシステムでのニーズに応えるため、新しいコンセプトの半導体メモ

リやストレージの開発も推進しています。例えば、酸化物半導体を用いた「OCTRAM」技術はより低消費電力、大容量DRAMの実現が期待でき、2030年代前半の実用化を目指して研究・技術開発を進めています。また、消費電力を抑えながら高速に大容量のデータを処理できる、DRAMよりも容量が大きく、NANDよりも高速な性能を持つSCM（ストレージクラスメモリ）（▶P.37）や、生成AIの進化に貢献する、より高速、低消費電力を目指すストレージ・SSDなどの研究・技術開発も行っています。

研究・技術開発においては、新技術や難度の高い技術に取り組みながら、開発スピードの向上や、消費電力の削減などサステナビリティも考慮する必要があります。当社グループは、フラッシュメモリの技術を軸としながらも、多種多様な分野における研究・技術開発を加速するため、人材の多様化や研究開発パートナーとの協業、AIの活用などさまざまな取り組みによって、ますます高度化する研究開発テーマに挑んでいきます。培ってきたメモリの技術をさらに発展させ、市場の課題を先取りし、時代の先を見据えた研究・技術開発を進めていきます。

キオクシア株式会社
常務執行役員
（技術統括責任者）

宮島 秀史

1 キオクシアとは

2 トップメッセージ

3 価値創造の取り組み

4 経営資本

最先端のフラッシュメモリ工場

▶テクノロジー

パートナーシップ

人材

5 ガバナンス

6 データセクション

パートナーシップ 社会関係資本



強みと取り組み

キオクシアグループは、顧客、研究開発パートナー、調達取引先などと強固な関係を構築しています。この強力なパートナーシップをさらに発展させ、社会ニーズを先取りした製品・サービスを実現し、高品質な製品を安定的に供給し、持続的に社会に価値を提供していくことを目指します。

顧客	研究開発パートナー	調達取引先
グローバルな営業・技術サポート・サプライチェーン体制を構築し、世界各地の顧客と共に、新たな価値を創出します。	国内外の技術団体、大学・研究機関、他企業などと連携して幅広く最先端の知見やアイデアを取り入れ、さらなる製品・技術の進化を目指します。	装置メーカー、材料メーカーなどとの共創で強靱なサプライチェーンを構築して高品質な製品を安定供給し、新しい製造技術の創出で競争力を強化します。

特 徴
9 の国・地域で 事業を展開
グローバルな市場ニーズにタイムリーに対応
データセンター、スマートフォン、PC分野の リーディングカンパニーとの強固な関係を構築
調達取引先や研究開発パートナーと連携し 安定的に製品・サービスを提供、イノベーションを創出

グローバルな事業展開

当社グループは9の国・地域に拠点をもち、グローバルに事業を展開しています。米国、欧州、アジアに販売・顧客サポートの拠点を構えており、多くの顧客と強固な関係を構築しています。



1 キオクシアとは

2 トップメッセージ

3 価値創造の取り組み

4 経営資本

最先端のフラッシュメモリ工場

テクノロジー

> パートナーシップ

人材

5 ガバナンス

6 データセクション

パートナーとの共創と対話

キオクシアグループは、データセンター、スマートフォン、PC分野のリーディングカンパニーと強固な関係を構築し、対話を深めています。また、生成AIや市場の今後のさらなる発展を見据えて、次世代のデータセンター技術の共同開発に取り組むなど、業界を超えたパートナーとのコラボレーションで社会に新たな価値を提供します。

TOPICS

共同開発の取り組み

次世代グリーンデータセンター技術開発

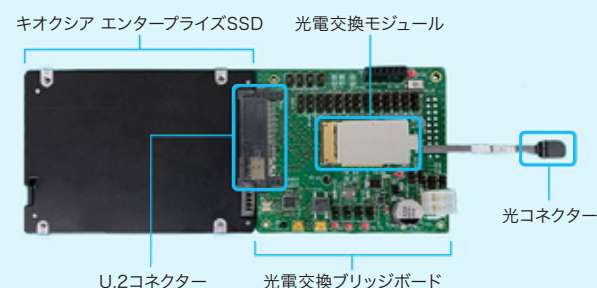
キオクシア(株)は、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の助成事業である「グリーンイノベーション基金事業/次世代デジタルインフラの構築における「次世代グリーンデータセンター技術開発」(JPNP21029)に、富士通(株)、1FINITY(株)、アイオーコア(株)、古河ファイテルオプティカルコンポーネンツ(株)、京セラ(株)、日本電気(株)と共に取り組んでいます。各社は分担して、データセンターの省エネルギー化・大容量化・低遅延化を実現する技術開発に取り組んでおり、これらの技術の適用に

より、研究開発開始時点のデータセンターと比較して、40%以上の省エネルギー化等の実現を目標としています。

キオクシア(株)は、光インターフェースに対応した「広帯域SSD」の開発を担当し、PCIe® 5.0に対応するプロトタイプによる動作を確認しました。

今後も次世代グリーンデータセンターの実現に向けて、生成AIをはじめとする大量のデータの高速処理を必要とする先進的なアプリケーションへの適合性を高める技術の開発とともに、将来の社会実装に向けた実証試験(PoC)への適用を進めていきます。

※PCIeはPCI-SIGの登録商標です。



パートナーとの対話

展示会でのコミュニケーション活動

当社グループは、顧客などのパートナーに最新製品・サービス、技術力を身近に感じていただき、対話を深めるためにさまざまなイベント・展示会に出展しています。

例えば、2024年8月に米国サンタクララにて開催された、フラッシュメモリとストレージの未来に焦点を当てた世界最大のイベント「the Future of Memory and Storage (FMS)」に出展し、第8世代BiCS FLASH™技術を適用した2Tb QLC製品、AIサーバー向けのNVMe™ SSDなどを紹介しました。FMSでは当社グループのSSD向けRAIDオフロード技術が「Best of Show Award」を受賞、3次元フラッ

シュメモリの開発に貢献した当社グループの従業員が「Lifetime Achievement Award」を受賞するなど、フラッシュメモリ技術の継続的な開発におけるリーダーシップが評価されています。

また、AIやデータセンター分野のリーディングカンパニーが開催する「NVIDIA GTC」「Dell Technologies World」「HPE Discover」などのカンファレンスにも出展し、AIソリューションにおける高性能ストレージの重要な役割をアピールしました。今後も顧客との対話を継続し、フラッシュメモリ業界での当社グループの存在感を高めていきます。



FMS 2024会場入り口の横断幕

1 キオクシアとは

2 トップメッセージ

3 価値創造の取り組み

4 経営資本

最先端のフラッシュメモリ工場

テクノロジー

＞パートナーシップ

人材

5 ガバナンス

6 データセクション

 人材 人的資本

強みと方針

キオクシアグループでは、多様なバックグラウンドを持つ人材が、研究・技術開発、生産、マーケティング・販売、管理などのさまざまな分野で活躍しています。1987年のNAND型フラッシュメモリの発明以来、これまで、数多くの世界初を生み出し、イノベーションを起こしてきました。

近年、人材の流動化やキャリアの多様化が進み、さらに、国内では少子高齢化の影響もあり、人材を取り巻く環境が大きく変化しています。一方で、フラッシュメモリの市場は拡大を続けており、かつ、市場変化や技術革新が速いという特徴があります。そのため、当社グループは、人材を積極的に採用・育成し、これまで培ってきた技術・技能を踏まえて、さらに新しい価値を生み出し、企業価値を向上するための仕組みづくりに取り組んでいます。加えて、多様な人材が能力を発揮することで、シナジーを生み出し、社会に価値を提供することを目指します。

特 徴

従業員数 15,261 名 (2025年4月末時点、キオクシアグループ)	新卒採用数 215 名 (2025年4月1日入社、 キオクシア(株)および国内グループ会社)
---	--

キャリア採用従業員比率 18.6 % (2024年度、対採用者数、キオクシア(株))	女性役職者数 101 名 (2025年3月末時点、キオクシア(株)、 女性活躍推進法の規定に基づき算出)
---	--

キオクシアグループのミッション・ビジョンのもとに、
持続的な事業の発展を支える人材

業界をリードする技術力や、高度で多様な専門性を持つ人材

多岐にわたるパートナーと共に社会に価値を創る人材



1 キオクシアとは

2 トップメッセージ

3 価値創造の取り組み

4 経営資本

最先端のフラッシュメモリ工場

テクノロジー

パートナーシップ

> **人材**

5 ガバナンス

6 データセクション

採用と育成

キオクシアグループでは、製品・サービスの市場ニーズの高まりや用途の拡大、技術の高度化・多様化に対応するため、多様な人材を積極的に採用・育成しています。

キオクシア（株）では、人材の育成と活用をより推進するため、教育委員会を設置し、事業計画に基づき、年度ごとに社内の教育実績をチェックし、改善提案や次年度の方針を審議しています。2024年度の教育委員会では、マネジメント教育の強化や、DX教育の全社展開などについて審議しました。

また、従業員一人ひとりが能力を発揮できる仕組みづくりに取り組んでいます。具体的には、人事評価制度の見直しや在宅勤務の制度化、年齢による役職定年の廃止を行いました。

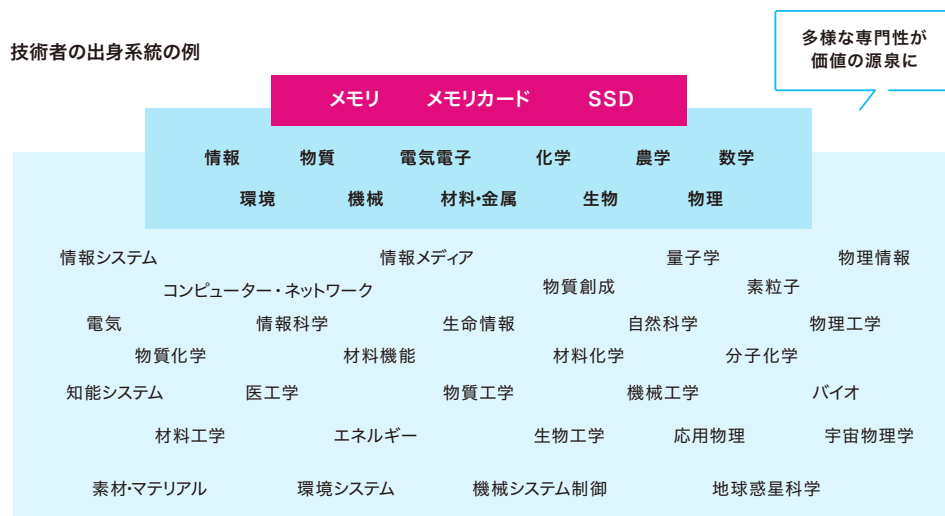
新卒採用、キャリア採用者数(キオクシア(株))

	2022年度	2023年度	2024年度
新卒採用者数 ^{※1}	401	511	276
キャリア採用者数 ^{※2}	282	25	63

※1 各年度の高卒・高専卒・大卒・大学院修了の定期採用者数(4月1日入社)

※2 各年度のキャリア採用者数

技術者の出身系統の例



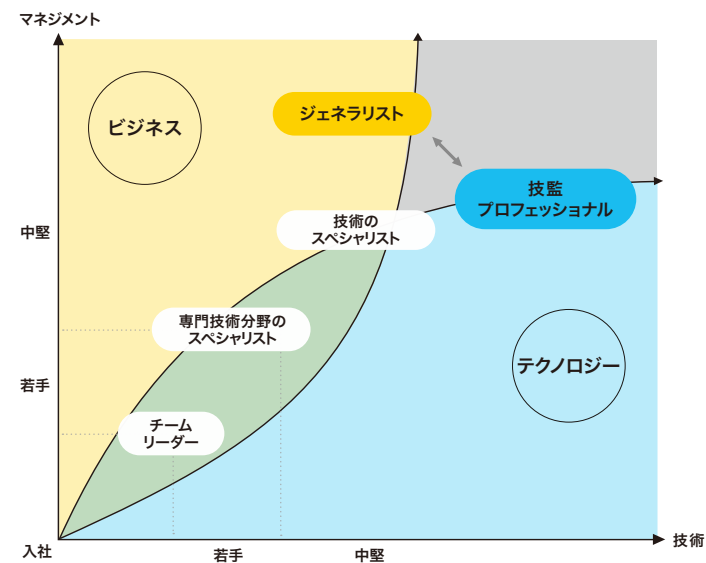
技術者育成

キオクシアグループは、高度化する技術ニーズに応えるため、技術者の育成に取り組んでいます。国内グループ[※]の新入社員に必要な素養を高めるための基礎研修を行い、入社2年目以降には開発に必要な専門技術講座を提供し、各職場ではメンターのもと、OJTや各種研修・教育を行っています。さらに、技術者として自発的にキャリアを形成できるよう、必要な学習を促進する職場環境づくりに取り組んでいます。技術者には、ビジネスと技術をつなげるジェネラリストへの道と、技術と技術をつなげ新たな価値を生み出すプロフェッショナルへの道があります。

また、研究開発と製品開発プロセスにおける高度な専門知識やノウハウについても、当社グループにおけるプロフェッショナルの最高位役職である技監により、次世代への技術伝承が行われています。

※キオクシア(株)および国内グループ会社

技術者育成



1 キオクシアとは

2 トップメッセージ

3 価値創造の取り組み

4 経営資本

最先端のフラッシュメモリ工場

テクノロジー

パートナーシップ

> 人材

5 ガバナンス

6 データセクション

従業員エンゲージメント

キオクシアグループでは、従業員を対象としたエンゲージメントサーベイを定期的 to 実施し、課題を把握した上で、その解決に向けた施策に取り組んでいます。

2024年度に実施した調査では、キオクシアグループ全体の88%の従業員から回答があり、分析の結果、会社の将来像や経営判断の背景などを従業員に伝えることが重要であると考え、対策として、経営幹部と従業員の対話集会を複数回にわたり行いました。今後もコミュニケーションのいっそうの改善を図ることにより、従業員エンゲージメントを高め、企業価値向上につなげていきます。

従業員エンゲージメント調査の実施サイクル



健康と安全

キオクシアグループでは、従業員一人ひとりの活力や心身の健康増進が事業活動を支える重要な基盤と考え、従業員や事業活動にかかわるすべての人々が安全で快適に働ける環境づくりに努めています。

当社グループは、製造・研究開発の事業場を中心に、労働安全衛生マネジメントシステム（ISO 45001：2018規格）認証を取得しています。このシステムに基づき、リスクアセスメントによる安全健康リスクの低減、および法令遵守の確認を継続的に行い、安全健康管理の可視化を進めています。

また、キオクシアホールディングス（株）およびキオクシア（株）は、経済産業省と日本健康会議が選定する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人（大規模法人部門）」に、2024年に続き2年連続で認定されました。2023年に「キオクシアグループ 健康経営宣言」を策定し、従業員向けの健康施策を健康投資^{※1}として位置づけ、「健康経営[®]」の実践に取り組んでいます。

※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

※1 健康投資：健康経営の考え方に基づいた具体的な取り組みのこと。



多様性の推進

グローバルな事業環境のもと、拡大・高度化・多様化する市場ニーズに応えていくには、人種、宗教、性別、国籍、障がいの有無、年齢、性的指向、性自認、性表現などにかかわらず、すべての従業員が個性・能力を発揮し活躍できる環境・風土を醸成することが不可欠です。キオクシアグループは、多様な人材がそれぞれの個性・能力を最大限に発揮するための機会や環境づくり、風土醸成に取り組めます。

中でも、女性従業員の活躍は注力すべき重要なテーマの一つと位置づけ、キオクシア（株）では以下の目標を定めています。

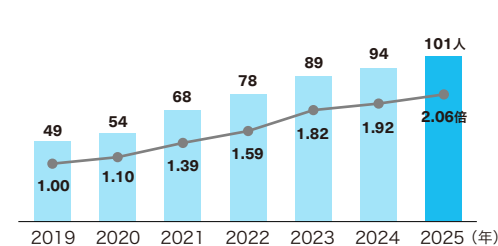
- 女性役職者数：2019年度の2倍（2025年度までに）
- 新卒採用に占める女性の比率：事務系45%以上、技術系15%以上

これらの目標は、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画にも定め、さまざまな施策を推進しています。

2025年6月時点では、女性役職者数と新卒採用に占める女性の比率（事務系）は目標を達成しています。また、男性の育児休職の取得も推進しており、2024年度のキオクシア（株）の男性の育児休職取得率は54.3%です。

キオクシア（株）における女性役職者育成・女性新卒採用の実績^{※1}

女性役職者数の推移^{※1}



※1 対象はキオクシア（株）における各年3月末時点の女性役職者（課長クラス以上）、キオクシアホールディングス（株）への出向者を含みます（中期目標の基準年として設定した2019年実績比）。2025年より、女性活躍推進法の規定に基づき算出し、出向者については、グループ内他社への出向者を含み、グループ外他社への出向者および他社からの出向者を除いています。従来の算出方法での女性役職者数の2025年実績は100人でした。

新卒採用者^{※2}に占める女性の比率^{※3}

	事務系	技術系
2020年度	25.0%	14.4%
2021年度	60.0%	11.5%
2022年度	53.3%	13.2%
2023年度	37.5%	8.7%
2024年度	30.4%	9.7%
2025年度	71.4%	14.3%

※2 大卒・大学院修了が対象です。

※3 キオクシア（株）における大卒・大学院修了の正規従業員の年度別入社実績です。なお、キオクシアホールディングス（株）は新卒採用を行っていません。

1 キオクシアとは

2 トップメッセージ

3 価値創造の取り組み

4 経営資本

最先端のフラッシュメモリ工場

テクノロジー

パートナーシップ

▶ 人材

5 ガバナンス

6 データセクション

人事総務部長メッセージ

多様なバックグラウンドを持つ人材が
働くことを誇りに思う会社に

人材が支えるキオクシアグループの持続的成長

人材はキオクシアグループの競争力の源泉で、事業が持続的に発展するために必要不可欠な経営資本です。フラッシュメモリの市場が拡大し、技術が高度化・多様化する中、当社グループは、優秀な人材を採用し、育て、一人ひとりが力を発揮するための仕組みづくりに注力しています。例えば、将来の就職先としてキオクシアに関心を持っていただくために、幅広い年代の学生に向けて、半導体メモリの理解やキオクシアの認知を広げる活動を行っています。従業員向けには、キャリア形成に必要なスキルを身につけ、自分らしく働くことができるよう、さまざまな教育・研修制度を整えるとともに、人事制度の見直しや在宅勤務の制度化などを行いました。さらに、教育委員会では、従業員が専門性を高め、能力を発揮するための施策について経営幹部が関連に議論し、仕組みづくりを進めています。

多様なバックグラウンドを持つ人材が
活躍する組織・風土づくり

社会が急速に変化し、お客様のニーズが多様化する中で、当社の競争力を高めるためには、多様なバックグラウンドを持つ人材が活躍できる組織・風土づくりが重要であると考えて

います。具体的には、多様な人材がシナジーを発揮するためのマネジメント力の強化や、『記憶』で世界をおもしろくするというミッションのもとに「製品・サービスにより新しい価値を生み出す」という意思統一が重要です。その実現に向け、従業員エンゲージメント調査から抽出された課題の一つである「経営幹部と従業員の距離」を縮めるため、経営幹部とさまざまな階層・職種の従業員が対話する機会を増やしています。また、多様性を推進する活動の中では、女性活躍推進のための施策に特に重点を置いています。当社グループには、役職を問わず、互いに「〇〇さん」と呼び合い、共通の目的に向かって自由に意見を出し合い、部門を超え一体となって取り組む風土があります。今後はさらに、多様な人材が切磋琢磨することで人的資本を高め、企業価値を持続的に向上する組織を創っていきます。

従業員の活躍の基盤となる健康経営に取り組む

従業員一人ひとりの活力や心身の健康は、事業活動を行う上で重要な基盤であると考えています。当社グループでは従業員が安全かつ快適に働ける職場づくりのため、健康経営の実践に積極的に取り組んでいます。

今後も健康と安全を第一に、従業員が自らの成長を感じ、誇りを持って働ける会社を目指していきます。

キオクシアホールディングス株式会社
常務執行役員
(人事総務部長)

沖代 恭太

1 キオクシアとは

2 トップメッセージ

3 価値創造の取り組み

4 経営資本

最先端のフラッシュメモリ工場

テクノロジー

パートナーシップ

> **人材**

5 ガバナンス

6 データセクション